

MICRO
nano
F A B S

COMPLETE LIST OF EQUIPMENT

M I C R O N A N O F A B S



PROCESSING TECHNIQUES

- Stepper NIKON i12D
- Implanter IBS
- EBL Raith 150 two
- FIB Zeiss 550L
- Aligner CMOS KS MA6
- Aligner MNC MA/BA 6
- KarlSüss GAMMA 80
- Laser Writer Kloé
- alineadora MA150cc
- Cleaner AMCOSS
- DRIE ALCATEL 601 E
- AMIRIE
- RIE Oxford S100-PRO
- DRIE AMS 110 DE
- RIE Sentech SI500
- RIE Sentech Si
- RIE Sentech Si MNC
- RTP ADDAX R1000
- RTA AS-one 200
- Wafer bonder KSüss
- Sputtering MRC 903
- Evapor. UNIVEX 450B
- Kenosistec KS 500
- Kenosistec KS 800H
- Evapor. Univex 400
- Sputtering AlN
- SEM ZEISS Auriga 40
- SEM Zeiss 1560XB
- AFM Bruker ICON
- AMIDEP
- JIPELEC

- RTCVD AS-Master 2000
- ALD Savannah 200
- PECVD Plasmalab 800
- Furn Centrotherm
- Furn HOBERSAL nwires
- PECVD Corial D350L
- Furns F13-F16
- Furns F9-F12
- Furns F1-F4
- Furns F5-F8
- PE-ALD PICOSUN
- Spinner DELTA 80
- Spinner Delta 20
- PR Spinn WS400A Lite
- AC8/1 AC8/2 bench
- Developer bench
- Solvents bench CMOS
- Spinner CMOS SPIN6
- Spinner Polyimide
- Spin coater Laurell
- Tepla PVA 300SA vell
- Chem bench AC1 AC2
- Chem bench AC3 AC4
- Chemical bench HF
- Chem bench AC5 AC6
- Chemical bench MNC
- Tepla Gigabatch 360M
- Grabado nitruro CMOS
- Grabado nitruro MNC
- ALCATEL GIR 160
- Diener P6
- PLASMOS
- CPD Tousimis, Euris
- Cabinet porous Si
- Electroplating

- 3D Optical Profiler
- KOH bench MNC
- KOH bench CMOS
- Confocal PL μ 2300
- Spinner Laurell
- Sputt LEYBOLD Z550
- Oven Heraeus E-42
- Evaporator Bio-Rad
- Chemical wet station
- Spinner nano Laurell
- Microscope ZeissAxio
- Spinner & developer
- NIL OBDUCAT-UV-2
- STS-Multiplex-AOE
- CORIAL-210IL
- TEPLA-PV200
- DIENER-Nano
- JEOL-IT800SHL-SEM-CL
- AMAT-CENTURA-5200DxZ
- CORIAL-D250L
- AIXTRON-Black-MagicPRO
- KENOSISTEC-Sputter-KS-500-C
- EMITECH-Sputter-K675X
- Pfeiffer-Classic-500-EBE-1
- Pfeiffer-Classic-500-EBE-2
- RAITH-150
- JEOL-JBX-8100FS
- BEAMER
- EVG620-MA
- SUSS-MA/BA8
- SUSS-NIL-MA/BA8
- SUSS-UV-SFT8
- Nanoscribe-Quantum-X
- EVG101-SC
- OBDUCAT-QS-200-SC

- OPTIwet-ST-30
- SUSS-SD12-LO
- SUSS-SD12-DEV
- OSIRIS
- Laurell-WS-1000
- NUAIRE-NU-156
- Idonus-HF-Etcher
- RENA-Compass
- MBY-E-Plating
- CARBOLITE-TZF-Furnace
- GALLUR-Furnace
- AllWin21-AW410
- Robotechnik-Optihot-HT24
- TEL-Hot-plate
- WITec-RAMAN/AFM
- Microscopio óptico Nomarski
- Sistema transferencia determinista 2D
- Sistema de espectroscopía 2D
- Perfilometro contacto
- Evaporadoras térmica Efecto Joule
- Evaporadora e-beam Amod
- Evaporadora e-beam Varian
- Evaporadora e-beam Balzers
- Sputtering LEICA
- Alineadora Óptica MJB4
- Alineadora Óptica MJB3
- Spinner/hot plate de 4"
- Litografía por haz de Electrones CRESTEC
- NanoFrazor
- Microscopio óptico Nomarski
- BEAMER and TRACER
- ICP-CVD Oxford
- ICP-RIE Oxford
- RTA para obleas de 2"

- Horno tubular de resistencias
- Plasma Oxígeno
- CVD Grafeno
- Sputtering AlN
- Ar ion milling
- Glove Box
- Micro-balanza
- Contador de partículas portátil
- Ar ion milling
- Sputtering spin-valve
- Sputtering para contactos metálicos
- Sputtering materiales magnéticos

MATERIAL GROWTH

- MBE MECA2000 nitruros
- MBE RIBER arseniuros
- MBE RIBER
- MBE Komponenten, arseniuros con fosfuros

DEVICE, CIRCUIT AND SYSTEM CHARACTERIZATION

- Drop Analyser DSA25E
- Microscope Wild M3B
- Laser MACSA D5010
- Profile TENCOR AS200
- 4puntas MNC ChangM
- Microscope LEITZ
- rt2 Tencor sonogage
- Semilab WT1000
- Filmetrics F20
- Nanospec 6100
- PROFORMA 300
- K&S HP Voltmeter
- 4Puntas CMOS ChangM
- KLA-Tencor P7 CMOS
- KLA-Tencor P7 MNC
- Elipsometer Horiba
- OM Leica DM8000
- INVENIO S
- Raman HORIBA
- Nanospec II
- SCIENION-sciFLEXARRAYER-S3
- COHERENT-Easy-Mark5-XL
- BRUKER-Vertex 80&Hyperion1000
- SENTECH-SENresearch 4.0
- SENTECH-SE-400ad
- CASCADE-SUMMIT200
- FLEXUS-FLX-2320-S
- KLA-Perfilometer-D600
- NIKON-LV150N
- LEICA-Lupa-M125C

- Zeiss-Axiolab-5
- SEM+CL+EDAX+nanoposicionadores
- AFM Bruker Fast Scan
- AFM Bruker ICON
- PL-UV
- PL-IR
- Banco FTIR
- Banco Fotodetectores MIR
- Banco láseres MIR
- Analizador redes 100 kHz
- Banco Fotodetectores UV-VIS-NIR
- Banco Láseres
- Espectrofotómetro de UV
- Raman
- DLOS/DLTS
- Efecto Hall
- Analizador parámetros de semiconductores HP4145B
- Capacímetros (LCR)
- XRD
- Relajómetro
- Estación puntas
- Parametrizador (nuevo) Agilent 4156C
- VSM
- AGFM
- Estación alta Temperatura
- Estación RF
- Analizador Redes
- Estación alta P, T
- Trazador
- Analizador parámetros de semiconductores HP4145B
- Capacímetros (LCR)
- Perfilometro de contacto
- Perfilometro óptico
- Perfilometro de contacto α -step

PACKAGING AND INTEGRATION

- Zeiss-Axiotron
- Leica-Wild M3Z
- Leica M205C
- COXEM-EM30
- XYZTEC-CONDOR EZ
- TPT-HB100
- TPT-HB16
- Martin-Clever Disp05
- SET-FC150
- Finetech-Fineplacer A4 Pico
- Ficontec-F300
- Micos-SF3000
- DISCO-TAPE
- DISCO-DCS1440
- Remet-LS250A
- Pselecta-210
- Branson-5510
- ATV-SRO704
- PacTech-SB2SM
- Robotank-VIT01
- DISCO-DAD3350
- Sputter Coater-S150B
- Thorlabs-CS20H2
- Soldadoras manual Kulicker and Sofa.Model 4524
- Soldadora automática HB100
- Cortadora
- Impresora 3D
- Pulidora
- Cortadora láser
- Campanas sala auxiliar